

卓上型ガス置換加熱炉



<1,200°C+手動運転仕様>

本装置は炉芯管内の試料に対し、ガスフローしながら加熱、加熱後の雰囲気ガスの分析を行うことを目的とした装置です。

先進中性子増倍材料の研究開発において、試料製作および製作した試料の熱安定性を評価するために使用いたします。

装置架台、加熱炉、炉芯管及びホルダー、真空排気系、分岐管部(ガス導入部、分析装置接続部等)で構成されています。

卓上型ガス置換加熱炉仕様

○到達圧力	×10 ⁻⁵ Pa以下※常温・無負荷時
○加熱最高温度	MAX1,200°C(カスタマイズによりMAX1,500°C可能)
○常用温度	1,100°C
○炉芯管形状	φ42mm×φ50mm×900mmL アルミナ管 (カスタマイズにより内径φ60mmも製作対応) 両端水冷構造
○ヒーター形状	カンタルスーパー円筒型φ55mm×φ260mm×500mmL 3ゾーン制御 (カスタマイズにより別サイズの製作可能)
○ヒーター制御	プログラムコントローラーによるPID制御
○真空排気系	ドライポンプ:125L/min[50Hz] ターボ分子ポンプ:63L/sec
○真空計	ピラニ真空計/電離真空計
○操作方法	手動(カスタマイズにより自動運転も製作可能)
○ユーティリティ	電気:AC200V三相6kVA 冷却水:5.0L/min以上 0.1MPa以上0.15MPa以下25°C以下循環 寸法:1,300mmW×600mmD×1,230mmH



<1,500°C+自動運転仕様>